

# ELECTRON BEAM DEVICE, DATA PROCESSING DEVICE FOR ELECTRON BEAM DEVICE, AND METHOD OF PRODUCING STEREO SCOPIC DATA OF ELECTRON BEAM DEVICE

Publication number: JP2002270126 (A)

Publication date: 2002-09-20

Inventor(s): TAKACHI NOBUO; KOIKE HIROTAMI +

Applicant(s): TOPCON CORP +

Classification:

- international: G01B15/00; G01B15/04; G01N23/04; G01N23/225; G21K5/00; G21K5/04; H01J37/22; H01J37/26; H01J37/28; H01L21/66; G01B15/00; G01N23/02; G01N23/22; G21K5/00; G21K5/04; H01J37/22; H01J37/26; H01J37/28; H01L21/66; (IPC1-7): G01B15/00; G01B15/04; G01N23/04; G01N23/225; G21K5/00; G21K5/04; H01J37/22; H01J37/26; H01J37/28; H01L21/66

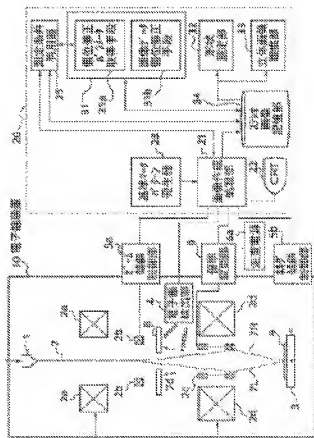
- European:

Application number: JP20010062686 20010306

Priority number(s): JP20010062686 20010306

## Abstract of JP 2002270126 (A)

**PROBLEM TO BE SOLVED:** To provide an electron beam device capable of appropriately processing stereo scopic detection data obtained from an electron microscope, three-dimensionally observing an image of a sample correctly and highly precisely, and measuring the three dimensional shape of the sample based on the observation. **SOLUTION:** The electron beam device comprises an electron beam source 1 for radiating an electron beam 7, an electronic optical system 2 for applying the electron beam 7 to a sample 9, a sample holder 3 for holding the sample 9, a sample inclining part for relatively inclining the sample holder 3 and the irradiated electron beam 7, an electron beam detecting part 4 for detecting the electron beam 7, coming out of the sample 9, and a data modifying part 31 for modifying the stereoscopic detection data at the time when the sample holder 3 and the irradiated electron beam 7 are relatively inclined to be in a prescribed relation.



Data supplied from the **espacenet** database — Worldwide

(5) IntCl. <sup>3</sup>	識別番号	F I	ページ数 (参考)
H 0 1 J	37/28	H 0 1 J 37/28	B 2 F 0 6 7
G 0 1 B	15/00	G 0 1 B 15/00	B 2 G 0 0 1
	15/04		4 M 1 0 6
G 0 1 N	23/04	G 0 1 N 23/04	5 C 0 3 3
	23/225		23/225

審査請求 未請求 請求項の数11 O L (全 15 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号 特願2001-62686(P2001-62686)

(22) 出願日 平成13年3月6日 (2001.3.6)

(71) 出願人 000220343

株式会社トプコン  
東京都板橋区蓮沼町75番1号(72) 発明者 高橋 伸夫  
東京都板橋区蓮沼町75番1号 株式会社ト  
プコン内(73) 発明者 小池 純民  
東京都板橋区蓮沼町75番1号 株式会社ト  
プコン内(74) 代理人 10009/320  
弁理士 宮川 真二 (外3名)

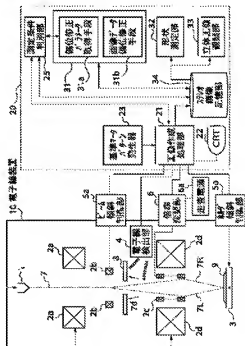
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 電子線装置、電子線装置用データ処理装置、電子線装置のステレオデータ作成方法

(57) 【要約】

【課題】 電子顕微鏡から得られたステレオの検出データを適切に処理して、試料像を正確に精度よく立体観察可能とし、かつこれに基づき三次元形状計測を行うことができる電子線装置を提供する。

【解決手段】 電子線7を放射する電子線源1と、電子線7を試料9に照射する電子光学系2と、試料9を保持する試料ホルダ3と、試料ホルダ3と照射電子線7とを相対的に傾斜させる試料傾斜部と、試料9から出射される電子線7dを検出する電子線検出部4と、試料ホルダ3と照射電子線7とを相対的に傾斜させた際のステレオの検出データを所定の関係にデータ修正するデータ修正部31とを備えている。



## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 電子線を放射する電子線源と；前記電子線を試料に照射する電子光学系と；前記試料を保持する試料ホルダと；前記試料ホルダと前記照射電子線とを相対的に傾斜させる試料傾斜部と；前記試料から出射される電子線を検出する電子線検出部と；前記試料ホルダと前記照射電子線とを相対的に傾斜させた際の、ステレオの検出データを所定の関係にデータ修正するデータ修正部と；を備える電子線装置。

【請求項2】 さらに、前記データ修正部により修正された修正データに基づき前記試料の形状を測定する形状測定部、若しくは前記データ修正部により修正された修正データに基づき、前記試料の立体的な画像を形成する立体画像観察部の少なくとも一方を備える；請求項1に記載の電子線装置。

【請求項3】 前記試料傾斜部は、前記試料を前記照射電子線に対して傾斜させるように構成されている；請求項1又は請求項2に記載の電子線装置。

【請求項4】 前記試料傾斜部は、前記照射電子線を前記試料に対して傾斜して照射するように前記電子光学系を制御するように構成されている；請求項1又は請求項2に記載の電子線装置。

【請求項5】 電子線検出部は、前記試料から出射される二次電子を検出するように構成されている；請求項1乃至請求項4の何れかに記載の電子線装置。

【請求項6】 前記試料は基準位置となる基準マークを有し、前記データ修正部は、前記基準マークを用いて、前記ステレオの検出データを単位修正データに修正する；請求項1乃至請求項5の何れかに記載の電子線装置。

【請求項7】 前記データ修正部は、基準テンプレートの基準マークを用いて、前記試料ホルダと前記照射電子線との相対的傾斜角度における単位修正パラメータを取得する単位修正パラメータ取得手段と；前記取得した単位修正パラメータを用いて、前記試料のステレオの検出データを単位修正データに修正する画像データ単位修正手段を有する；請求項1乃至請求項5の何れかに記載の電子線装置。

【請求項8】 電子線を放射する電子線源、前記電子線を試料に照射する電子光学系、前記試料を保持する試料ホルダ、前記試料ホルダと前記照射電子線とを相対的に傾斜させる試料傾斜部、前記試料から出射される電子線を検出する電子線検出部を有する電子線装置と接続される電子線装置用データ処理装置であって；前記試料ホルダと前記照射電子線とを相対的に傾斜させた際のステレオの検出データを受け取り、前記ステレオの検出データを所定の関係にデータを修正するデータ修正部；を有する電子線装置用データ処理装置。

【請求項9】 さらに、前記データ修正部により修正された修正データに基づき前記試料の形状を測定する形状

測定部、若しくは前記データ修正部により修正された修正データに基づき、前記試料の立体的な画像を形成する立体画像観察部の少なくとも一方を備える；を備える請求項8に記載の電子線装置用データ処理装置。

【請求項10】 電子線を放射する電子線源、前記電子線を試料に照射する電子光学系、前記試料を保持する試料ホルダ、前記試料ホルダと前記照射電子線とを相対的に傾斜させる試料傾斜部、前記試料から出射される電子線を検出する電子線検出部を有する電子線装置を用いて、前記試料の形状を測定し、若しくは前記試料の立体的な画像を形成する為の電子線装置のステレオデータ作成方法であって；前記試料には基準位置となる基準マークが作成されており；前記試料ホルダと前記照射電子線とが第1の相対的傾斜角度をなす状態において、前記電子線検出部で第1の検出データを検出し；前記試料ホルダと前記照射電子線とが第2の相対的傾斜角度をなす状態において、前記電子線検出部で第2の検出データを検出し；前記基準マークを用いて、前記第1及び第2の検出データを単位修正データに修正する；電子線装置のステレオデータ作成方法。

【請求項11】 電子線を放射する電子線源、前記電子線を試料に照射する電子光学系、前記試料を保持する試料ホルダ、前記試料ホルダと前記照射電子線とを相対的に傾斜させる試料傾斜部、前記試料から出射される電子線を検出する電子線検出部を有する電子線装置を用いて、前記試料の形状を測定し、若しくは前記試料の立体的な画像を形成する為の電子線装置のステレオデータ作成方法であって；前記試料の代わり、基準位置となる基準マークが作成された基準テンプレートを前記試料ホルダに挿入し；前記試料ホルダと前記照射電子線とが第1及び第2の相対的傾斜角度をなす状態において、前記電子線検出部で前記基準テンプレートに対する第1及び第2の検出データを検出し；前記基準マークを用いて前記試料ホルダと前記照射電子線との相対的傾斜角度における単位修正パラメータを取得し；前記試料を前記試料ホルダに挿入し；前記試料ホルダと前記照射電子線とが第1及び第2の相対的傾斜角度をなす状態において、前記電子線検出部で前記試料に対する第1及び第2の検出データを検出し；前記取得した単位修正パラメータを用いて、前記試料の第1及び第2の検出データを単位修正データに修正する；電子線装置のステレオデータ作成方法。

## 【発明の詳細な説明】

## 【0001】

【産業上の利用分野】この発明は、電子顕微鏡により得られた画像をステレオ観察可能な画像とし、試料の形状を求めたりする電子線装置、電子線装置用データ処理装置、電子線装置のステレオデータ作成方法に関する。

## 【0002】

【従来の技術】透過型電子顕微鏡（TEM）の場合には試料を傾斜させ、異なる傾斜角度の透過画像を得て、これを左右画像としてステレオ観察が行われている。また、走査型電子顕微鏡（SEM）の場合には試料を傾斜させたり、電子線を傾斜させたりして、異なる傾斜角度の反射画像を得て、これを左右画像としてステレオ観察が行われている（「医学・生物学電子顕微鏡観測法」第278頁～第291頁、1982年刊行参照）。そして、肉眼においてステレオ観察をする場合のように、試料の概略的な凸凹形状を観察する用途には十分な画像が得られている。

【0003】

【発明が解決しようとする課題】他方、異なる傾斜角度の画像から左右画像を得てステレオ観察を行って、試料の正確な三次元形状の計測を行う場合には、電子顕微鏡の電子レンズ系における収差の影響や試料の傾斜角度、或いは電子線の傾斜角度を数分程度の非常に正確な角度で制御する必要がある。しかしながら、従来の傾斜角度は数度若しくは数分程度の粗い制御しか行われておらず、左右画像の立体感から正確な三次元形状の計測を行うには不十分であるという課題があった。

【0004】本発明は、上述した課題を解決したもので、電子顕微鏡から得られたステレオの検出データを適切に処理して、試料像を正確に精度よく立体観察可能とし、かつこれに基づき三次元形状計測を行うことができる電子線装置、電子線装置用データ処理装置、電子線装置のステレオデータ作成方法を提供することを目的とする。

【0005】

【課題を解決するための手段】上記課題を達成する本発明の電子線装置は、図3、図15、並びに図16に示すように、電子線7を放射する電子線源1と、電子線7を試料9に照射する電子光学系2と、試料9を保持する試料ホルダ3と、試料ホルダ3と照射電子線7とを相対的に傾斜させる試料傾斜部5と、試料9から出射される電子線7を抽出する電子線検出部4と、試料ホルダ3と照射電子線7とを相対的に傾斜させた際のステレオの検出データを所定の関係にデータ修正するデータ修正部31とを備えている。

【0006】ここで、試料傾斜部は、試料ホルダ3の傾斜角度を制御して、試料9を照射電子線7に対して傾斜させるホルダ傾斜制御部5aを用いて構成されていてもよい。或いは、試料傾斜部は、照射電子線7を試料9に対して傾斜して照射するように電子光学系2を制御するビーム傾斜制御部5aを用いて構成されていてもよい。また、電子線検出部4は、試料9から出射される二次電子を抽出するように構成されていると、走査型電子顕微鏡として好ましい。

【0007】また、ステレオの検出データとは、試料ホルダ3と照射電子線7とが第1及び第2の相対的傾斜角

度をなす状態において、電子線検出部4で試料9に対する第1及び第2の検出データを検出することを言う。試料ホルダ3と照射電子線7とが第1及び第2の相対的傾斜角度をなす状態は、図3に示すように、ビーム傾斜制御部5aを用いる場合には第1の相対的傾斜角度では照射電子線7となり、第2の相対的傾斜角度では照射電子線7となる。また、図15並びに図16に示すように、ホルダ傾斜制御部5bを用いる場合には第1の相対的傾斜角度では試料ホルダ3の傾斜角度Rとなり、第2の相対的傾斜角度では試料ホルダ3の傾斜角度Lとなる。

【0008】データ修正部31の「所定の関係にデータを修正する」とは、ステレオの検出データとしての2枚の画像の補正を行い、傾位修正できる状態にすることを言う。傾位修正とは、傾斜して検出された画像データの歪みを直し、縮尺を一定に統一することを言う。画像の補正とは、試料9に照射電子線7を照射したときと同じ投影状態で、2枚の画像データを逆投影して立体視できるように、空中三角測量のデータ処理方法に準拠して、試料9の三次元形状測定や立体的な画像を形成できる状態にすることを言う。

【0009】好ましくは、本発明の電子線装置は、さらにデータ修正部31により修正された修正データに基づき試料9の形状を測定する形状測定部32、若しくはデータ修正部31により修正された修正データに基づき、試料9の立体的な画像を形成する立体画像観察部33の少なくとも一方を備える構成とする。

【0010】好ましくは、試料9は基準位置となる基準マークを有し、データ修正部31は、前記基準マークを用いて、前記ステレオの検出データを傾位修正データに修正する構成とする。試料9に設けられた基準マークを用いてステレオの検出データを傾位修正データに修正することが容易に行える。基準マークは、試料9に電子線7を照射して形成したり、試料9に既に存在するパターン等の特徴点を用いる。

【0011】好ましくは、データ修正部31は、基準テンプレートの基準マークを用いて、試料ホルダ3と照射電子線7との相対的傾斜角度における傾位修正パラメータを取得する傾位修正パラメータ取得手段31aと、取得した傾位修正パラメータを用いて、試料9のステレオの検出データを傾位修正データに修正する画像データ傾位修正手段31bを有する構成とする。基準テンプレートを用いて傾位修正が容易に行える。画像データ傾位修正手段31bは傾位修正パラメータ取得手段31aで取得した傾位修正パラメータを用いて、試料9のステレオの検出データを傾位修正データに修正するので、試料9に基準マークを作成する必要がなく、測定効率が高くなる。傾位修正パラメータ取得手段31aで取得する傾位修正パラメータは、画像データ傾位修正手段31bで傾位修正する試料9のステレオの検出データを検出した

試料ホルダ3と照射電子線7との相対的傾斜角度で取得するのが戦正のため望ましい。

【0012】上記課題を達成する本発明の電子線装置用データ処理装置は、図3、図15、並びに図16に示すように、電子線装置10に接続されるデータ処理装置20であって、試料ホルダ3と照射電子線7とを相対的に傾斜させた際のステレオの検出データを受け取り、所定の関係にデータを修正するデータ修正部31とを備えている。ここで、電子線装置10は、電子線7を放射する電子線源1と、電子線7を試料9に照射する電子光学系2と、試料9を保持する試料ホルダ3と、試料ホルダ3と照射電子線7とを相対的に傾斜させる試料傾斜部と、試料9から出射される電子線7dを検出する電子線検出部4とを有する。

【0013】好ましくは、本発明の電子線装置用データ処理装置は、さらにデータ修正部31により修正された修正データに基づき試料9の形状を測定する形状測定部32、若しくはデータ修正部31により修正された修正データに基づき、試料9の立体的な画像を形成する立体画像傾斜部33の少なくとも一方を備える構成とする。

【0014】上記課題を達成する本発明の電子線装置のステレオデータ作成方法は、図11に示すように、試料9には基準位置となる基準マークが作成されており（S311、S314）、試料ホルダ3と照射電子線7とが第1の相対的傾斜角度をなす状態において、電子線検出部1で第1の検出データを検出し（S316）、試料ホルダ3と照射電子線7とが第2の相対的傾斜角度をなす状態において、電子線検出部4で第2の検出データを検出し（S316）、前記基準マークを用いて、前記第1及び第2の検出データを傾位修正データに修正する（S322、S326）工程を有している。

【0015】上記課題を達成する本発明の電子線装置のステレオデータ作成方法は、図6に示すように、試料9の代わりには、基準位置となる基準マークが作成された基準テンプレート40を試料ホルダ3に挿入し（S204）、試料ホルダ3と照射電子線7とが第1及び第2の相対的傾斜角度をなす状態において、電子線検出部4で基準テンプレート40に対する第1及び第2の検出データを検出し（S206）、前記基準マークを用いて試料ホルダ3と照射電子線7との相対的傾斜角度における傾位修正パラメータを取得する（S208、S210）。

【0016】続いて、図10に示すように、試料9を試料ホルダ3に挿入し（S252）、試料ホルダ3と照射電子線7とが第1及び第2の相対的傾斜角度をなす状態において、電子線検出部4で試料9に対する第1及び第2の検出データを検出し（S254）、前記取得した傾位修正パラメータを用いて、試料9の第1及び第2の検出データを傾位修正データに修正する（S258、S260）。

## 【0017】

【発明の実施の形態】「ステレオ画像を用いた三次元形状測定の原理」まず、本発明の電子線装置を説明する前に、傾斜角の異なる二つの画像を立体視可能な画像に傾位修正し、立体観察を行うと同時に三次元計測を行う測定原理について説明する。図1は3本の同じ長さの直線パターンが等間隔に存在している被写体に対して所定の傾斜角度で撮影したステレオ画像の説明図で、図1（A）は0度（平行）、図1（B）は10度傾斜している場合を示している。平行の場合、図1（A）に示すように、等間隔dで同じ長さlの直線パターンが映っていた場合、10度傾いた画像では、図1（B）に示されるように異なる間隔 $d_1$ 、 $d_2$ で、異なる長さ $l_1$ 、 $l_2$ となる。

【0018】図1（A）と図1（B）の画像をステレオメータ（視差測定かん）で立体視しようとしても、立体視ができないばかりでなく、視差の測定に基づく比高の正確な計測もできないという課題がある。さらに三次元計測するために画像相関処理によるストロオマッチングを行おうとしても、左右画像の傾斜角度が異なるために旨いかないという課題がある。

【0019】図2は図1（A）、（B）の傾斜画像を傾位修正画像に修正したステレオ画像の説明図で、図2（A）、（B）共に平行状態に傾位修正している場合を示している。傾位修正された結果、傾いて撮影された図1（A）、（B）の傾斜画像は対象物に対して平行となり、幅尺も等しくなって視差が除去されて、図2（A）、（B）に示されるように立体視が可能となる。立体視可能なステレオ画像は、同一エピホラライン上にある左右画像の対応点を求めることにより正確な三次元座標が求めることができるようになる。傾位修正画像を生成するためには、2枚の画像上で最低3点以上の既知の基準点座標が画像上に必要である。

【0020】また、それら基準点から、二つの画像の傾き、位置（これらを外部固定要素と呼ぶ）等を算出することができる。これら外部固定要素が最初から決まっていれば傾位修正処理を行うことができる。本発明においては、傾位修正画像を生成するために基準点となる基準マークを有する基準テンプレートを予め作成、若しくは試料面上に電子線で撮影中に試料に基準点となる基準マークを作成し、画像の傾位修正処理によるデータ修正をして外部固定要素を求めるものである。傾位修正処理後のステレオ画像は、立体視可能であると同時に三次元計測も可能な状態となっている。

【0021】〔第1の実施の形態〕以下、本発明の実施の形態を図面により説明する。図3は本発明の第1の実施の形態を説明する構成ブロック図で、走査用加速鏡の電子線を偏角させてステレオ画像を得る場合を示している。図において、走査型顕微鏡としての電子線装置10は、電子線7を放射する電子線源1、電子線7を試料9

に照射する電子光学系2、試料9を傾斜可能に保持する試料ホルダ3、電子光学系2の倍率を変える倍率変更部6、倍率変更部6に電力を供給する走査電源6a、電子線7を検出する検出器4、電子線7を傾斜制御する傾斜制御部5としてのビーム傾斜制御部5a、試料9から射出される二次電子のエネルギーを減衰させて検出器4に反射させる二次電子変換ターゲット8を備えている。なお、試料ホルダ3を傾斜制御する傾斜制御部5としてのホルダ傾斜制御部5bは、第1の実施形態で用いないが、後で説明する第2の実施形態で用いる。

【0022】電子光学系2は、電子線源1から放射された電子線7の電子流密度、開き角、照射面積等を変えるコンデンサレンズ2a、電子線7の試料面上の入射角度を制御する偏向レンズ2b、細かく絞られた電子線7を偏向して試料面上に二次元的に走査させる走査レンズ2c、最終収縮小レンズの働きと共に試料面上での入射プローブの焦点合わせを行う対物レンズ2dを備えている。倍率変更部6の倍率変更命令に従って、走査レンズ2cにより電子線7を走査する試料面上の領域が定まる。ビーム傾斜制御部5aは偏向レンズ2bに傾斜制御信号を送り、試料ホルダ3と照射電子線7とが第1の相対傾斜角度をなす電子線7Rと、第2の相対傾斜角度をなす電子線7Lとで切替えている。なお、ビーム傾斜制御部5aによる試料ホルダ3と照射電子線7の相対傾斜角度は、2個に隔ちる多段に最小してよいが、ステレオの検出データを得る為には最小2個必要である。

【0023】試料9は、例えばシリコン半導体やガリウム、ヒ素半導体のような半導体のチップであるが、電力用トランジスタ、ダイオード、サイリスタのような電子部品でもよく、また液晶パネルや有機ELパネルのようなガラスを用いた表示装置部品でもよい。典型的な走査型顕微鏡の観察条件では、電子線源1は $3\text{ kV}$ 、試料9は $2\sim 4\text{ kV}$ に増加されている。試料9から放出された二次電子は、二次電子変換ターゲット8に衝突して、エネルギーが弱められて検出器4で検出される。なお、試料9をマースドンシヤルにした場合には、二次電子は霧のように振る強いエネルギーが弱く、検出器4で直接検出することができ、二次電子変換ターゲット8は不要である。

【0024】データ処理装置20は、画像作成処理部21、表示装置22、基準マークパターン発生器23、測定条件判別部25、データ修正部31、形状測定部32、立体画像観察部33、並びにステレオ画像記憶部34を有している。画像作成処理部21は、走査レンズ2cにより電子線7が試料面上の領域を走査する際に、検出器4で検出される二次電子像を用いて、試料面上の画像を作成する。表示装置22は画像作成処理部21で作成された画像をオペレータが観察できるように表示するので、例えばCRTや液晶パネルが用いられる。表示装置22は通常の一面図モニタでもよく、ステレオ表示

可能なモニタでもよく、或いは両方備えていてもよい。

【0025】基準マークパターン発生器23は、電子線7を制御して試料9に基準マークを作成するものである。好ましくは、基準マークパターン発生器23に、予め試料9の面上からパターン形状やエッチングパターン等から特徴点を抽出し、既に存在する特徴点で不足する場合に基準マークを作成すべき位置と個数を定める機能も持たせるとよい。基準テンプレートに基準マークを作成する場合にも、基準マークパターン発生器23に基準マークの作成数と作成位置を記憶させておくともよい。

【0026】測定条件判別部25は、電子線装置10の種類、並びに電子光学系3の倍率の情報をを用いて測定条件の判別を行う。電子線装置10の種類としては、透過型電子顕微鏡や走査型電子顕微鏡の別がある。電子光学系2の倍率としては、低倍率と高倍率の区別があり、例えばデータ修正部31において複数傾斜角度での検出データを補正する演算形態として、中心投影と平行投影のどちらを選択するかを要求して用いる。

【0027】データ修正部31は、画像作成処理部21で作成した画像を補位修正画像に修正して立体視可能なステレオ画像とするもので、リアルタイムで補位修正画像に修正する場合は直接、画像作成処理部21から電子顕微鏡10での測定条件を受け取っている。なお、電子顕微鏡10での測定条件は、一旦ステレオ画像記憶部34に画像を記憶させている場合は、測定条件判別部25から受取ってもよく、またステレオ画像記憶部34に画像と共に記憶された電子顕微鏡10での測定条件を用いてもよい。形状測定部32は、データ修正部31により修正されたステレオ画像に基づき試料9の三次元形状を測定する。立体画像観察部33は、データ修正部31により修正されたステレオ画像に基づき試料9の立体的な画像を形成する。ステレオ画像記憶部34は、画像作成処理部21で作成した画像を記憶すると共に、データ修正部31により修正されたステレオ画像を記憶するもので、例えば磁気ハードディスク、CD-RやDVD、フロッピー（登録商標）ディスク、光磁気ディスクのような情報記憶媒体に画像データを記憶している。なお、ステレオ画像記憶部34が、画像作成処理部21で作成した補位修正されていない画像を記憶する場合は電子顕微鏡10での測定条件も記憶しておくもよい。

【0028】データ修正部31は、基準位置となる基準マークを有する試料9を用いて直接データ修正する場合と、基準マークを有する基準テンプレートを用いて試料9のデータ修正をする場合の2通りに対処している。試料9が基準位置となる基準マークを有する場合は、データ修正部31は基準マークを用いて、ステレオの検出データを補位修正データに修正する。

【0029】基準マークを有する基準テンプレートを用いて試料9のデータ修正をする場合に備えて、データ修正部31は補位修正パラメータ取得手段31aと画像修

ータ偏位修正手段31bとを有している。偏位修正パラメータ取得手段31aは、基準テンプレートの基準マークを用いて、ステレオの検出データを得る試料ホルダ3と照射電子線7との相対傾斜角度における偏位修正パラメータを取得する。ここで、ステレオの検出データとは、試料ホルダ3と照射電子線7とが第1及び第2の相対傾斜角度をなす状態において、電子線検出部4で試料9に対する第1及び第2の検出データを検出することを含む。画像データ偏位修正手段31bは、取得した偏位修正パラメータを用いて、試料9のステレオの検出データを偏位修正データに修正する。

【0030】図4は試料若しくは基準テンプレート基板に形成する基準マークの説明図で、(A)は四隅に基準マークを有する平面図、(B)は格子状に基準マークを有する平面図、(C)はレンズ歪補正用の基準テンプレートの断面図である。試料9の場合には、四隅に基準マーク9aを形成すると、データ修正部31による偏位修正がしやすい。基準マーク9aは試料9のなるべく広い範囲に3点以上形成すると使いやすい。基準マーク9aとは、三次元位置が既知の基準点である。基準テンプレート40でも、四隅に基準マークを形成してよい。基準テンプレート40とは、ステレオ画像を形成する基準面となる平面図を有するもので、好ましくは試料9を構成する材料と同一の組成成分を有し、凸凹のない平坦なものがよい。基準テンプレート基板40bとは、基準マークを作成して基準テンプレート40とする基板である。

【0031】基準テンプレート40の場合には、基準マーク40aを基準テンプレート基板40bの任意の位置に形成できるので、例えば格子状に基準マークを形成する。格子状に基準マークを設けると、外部測定要素に加えて電子線のレンズ歪で補正するのにも用いることができる。電子線のレンズ歪を補正する場合は、平坦な基準テンプレートの場合には複数方向から撮影する必要がある。図4(C)のように基準テンプレートに段差を付けて、且つこの段差方向の縁に格子状に基準マークを設けると、基準マークに高さ成分が含まれるため、電子線のレンズ歪が正確に補正できる。なお、レンズ歪にはザイデル収差である球面収差、コマ収差、湾曲収差、非点収差、歪み収差等があり、色収差として軸上収差、倍率色収差、回色色収差がある。

【0032】【試料若しくは基準テンプレート基板に基準マークを作成する方法】続いて、試料若しくは基準テンプレート基板に基準マークを作成する方法について説明する。試料9や基準テンプレート基板40bの場合には、基準マークパターン発生器23を用いて電子線7を位置決めして照射することでコンタミネーション、光漏等を試料9面上に形成して基準マークとすることができる。電子線7を用いることで、基準マークは非常に精密な位置決め精度で試料9や基準テンプレート基板40b

に形成される。

【0033】コンタミネーションは試料上の炭化水素の分子が電子線照射により焼き付く現象で、その大きさは、電子線のプロファイルに依存するが、電子線密度、照射時間が大きいほど、コンタミ量は多くなり、ほぼ視野を持つ円柱状に育つ。従ってアローブをゆくりと走査させると、コンタミネーションはその走査の形状に沿って付くようになる。コンタミネーションを任意の形状や任意の分布をさせるには、その形状に従って電子線アローブを走査して一定時間保持する、コンタミネーションを作成する場合、その大きさをビーム径、電流密度で電子線密度、照射時間を制御する。画像処理しやすくするために、基準マークは、画像上で10画素以上とするのが望ましく、照射するビーム径を画素以上にする、好ましくは、基準マークパターン発生器23に電子線照射制御の最適値を設定しておく。

【0034】コンタミネーションが付きやすい時は、照射系の一部に電子線7をカットするビームブランキングを設けて、電子線の走査に伴う移動の時は、電子線7が試料9に当たらなくするといふ。また、検出器4から得られる二次電子信号のレベルを基準マークパターン発生器23に帰還して、電子線7の照射時間を調整することによりコンタミネーションの量を制御することができる。

【0035】図5は試料若しくは基準テンプレート基板に基準マークを作成する手順を示す流れ図である。まず、基準マークを作成する試料9若しくは基準テンプレート基板40bを試料ホルダ3に収容し、基準マークパターン発生器23に基準マークを作成する位置を読み込ませる(S100)。そして、電子線源1から電子線7を照射しつつ、走査レンズ2cにより電子線7を試料9若しくは基準テンプレート基板40bの面上でスキャンさせる(S102)。次に、電子線7の照射位置が、予めプログラムされた基準マークの作成位置か確認する(S104)。基準マークの作成位置であれば、電子線7をその位置で停止させ(S106)。電子線7を照射させる(S108)。ここで検出器4によって得られた信号が予め設定された閾値以上か判定し、閾値以上となるまで基準マークの作成位置にて照射し続ける(S110)。閾値以上となると、基準マークを所定数作成したか確認する(S112)。既に所定数に達していなければ、S102に戻り、再び電子線7をスキャンさせ、所定数の基準マークを作成していれば終了する(S114)。

【0036】なお、図4(C)のように基準テンプレート基板40bに段差の形状があつて、コンタミネーションを段差上に付ける場合は次のように行う。まず、基準テンプレート基板40bの段差の作製は、レジストの露光、エッチングを繰り返すことにより任意の形状で段差を作ることが可能である。電子線照射は焦点深度が高い

ため段差の注意の場所に電子線プローブをとどめることにより、電子線プローブが止まったところにコンタミネーションの基準マークを作ることが可能である。

【0037】このように作成された基準テンプレートをを用いて偏位修正パラメータを取得する処理手順について説明する。図6は基準テンプレートをを用いて偏位修正パラメータを取得する処理の流れ図である。まず、電子顕微鏡の倍率を決定する(S202)。これによって中心投影と平行投影が決定する。なお、中心投影と平行投影については後で説明する。次に、基準マークを有する基準テンプレート40を試料ホルダ3にセットする(S204)。外部標準要素を補正する場合は、基準マークが3点以上の基準テンプレート40を用い、レンズ歪補正まで行う場合は基準マークが多数作成されている方の基準テンプレート40を使用する。ただし、外部標準要素のみであっても、基準マークが多数作成されている基準テンプレート40を使用することもできる。また、レンズ歪補正を正確に行う場合は、段差付きの基準テンプレート40が望ましい。

$$R(a, b) = \frac{N-1}{n} \sum_{m=1}^{N-1} \sum_{n=1}^{N-1} |U_{ab}(m_1, n_1) - T(m_1, n_1)| \quad \dots (1)$$

ここで、 $T(m_1, n_1)$ は探索画像、 $U(a, b)(m_1, n_1)$ は対象画像の部分画素、 $(a, b)$ は探索画像の左上座標、 $R(a, b)$ は残差である。残差 $R(a, b)$ が最小になる点が求める画像の位置である。処理の高速化をはかるため、式(1)の加算において、 $R(a, b)$ の値が過去の残差の最小値を越えたら加算を打ち切り、次の $R(a, b)$ に移るよう計算処理を行う。

【0040】再び図6に戻り、基準マークを用いて、ステップ5の検出データを得る試料ホルダ3と照射電子線7との相対的傾斜角度における偏位修正パラメータの計算を行う(S210)。計測された基準マークの画像座標と実際の座標から、中心投影の場合は後述する式(2)～(4)を使って偏位修正パラメータを算出する。平行投影の場合は式(5)、(6)を使って偏位修正パラメータを算出する。レンズ歪補正まで行う場合は、式(7)を使って偏位修正パラメータを算出する。そして、試料ホルダ3から基準テンプレート40を取り出して、偏位修正パラメータの取得が完了する(S212)。

【0041】〔平行投影と中心投影〕電子顕微鏡では倍率が低倍率～高倍率(例、数倍～数百万倍)までレンジが幅広いので、電子光学系2が低倍率では中心投影、高倍率では平行投影とみなせる。中心投影と平行投影とを

【0038】試料ホルダ3と照射電子線7とが第1及び第2の相対的傾斜角度をなす状態において、電子線検出部4で基準テンプレート40に対する第1及び第2の検出データを検出する(S206)。外部標準要素の補正であれば、この第1及び第2の相対的傾斜角度は試料9を計測するのと同じ角度とし、少なくとも2方向以上の傾斜角度にて撮影する。レンズ歪補正を行う場合は、試料9を計測するのと同じ2方向の傾斜角度に加えて、第3の傾斜角度(例えばプラス3方向)から撮影する。次に、撮影された画像から画像相関処理等を用いて基準マークを検出して、計測する(S208)。

【0039】図7は画像相関処理の説明図である。図中、探索画像Tは縦N1、横M1で左上座標が(a, b)となっている小さな矩形図である。対象画像Iは縦M、横Nの大きな矩形図である。画像相関処理は、正規化相関法や残差逐次検定法(SSDA法)など、どれを用いてもよい。残差逐次検定法を使用すれば処理が高速化できる。残差逐次検定法は次式を用いる。

【数1】

切替える倍率は、偏位修正パラメータの算出精度を基準にして定めるのがよく、例えば100倍乃至1000倍から適宜選択される。図8は中心投影の説明図である。中心投影の場合、投影中心点O<sub>c</sub>を基準にして試料9の置かれる対象座標系50と、検出器4の置かれる画像座標系52が図8のような位置関係にある。対象座標系50における基準マークのような対象物の座標を(X, Y, Z)、投影中心点O<sub>c</sub>の座標を(X<sub>0</sub>, Y<sub>0</sub>, Z<sub>0</sub>)とする。画像座標系52における座標を(x, y)、投影中心点O<sub>c</sub>から画像座標系52までの画面距離をCとする。このとき、中心投影式として次式が成立する。

【0042】

【数2】

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ -C \end{bmatrix} = k \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X - X_0 \\ Y - Y_0 \\ Z - Z_0 \end{bmatrix} \quad \dots (2)$$

ここで、kは係数、 $a_{ij}$ :( $i=1,2,3$ ;  $j=1,2,3$ )は回転行列の要素である。式(2)を画像座標系52の座標(x, y)について解くと次式が成立する。

【数3】

$$\begin{cases} x = -C \frac{(X - X_0)a_{31} + (Y - Y_0)a_{32} + (Z - Z_0)a_{33}}{(X - X_0)a_{11} + (Y - Y_0)a_{12} + (Z - Z_0)a_{13}} \\ y = -C \frac{(X - X_0)a_{21} + (Y - Y_0)a_{22} + (Z - Z_0)a_{23}}{(X - X_0)a_{11} + (Y - Y_0)a_{12} + (Z - Z_0)a_{13}} \end{cases} \quad \dots (3)$$



また、回転行列の要素 $a_{ij}$ は画像座標系52の対象座標系50を構成する3軸 $X, Y, Z$ に対する傾き $\phi$ 、

$\psi$ 、 $\kappa$ を用いて次のように表せる。

【数4】

$$\begin{pmatrix} a_{11} = \cos\phi\cos\psi & a_{12} = -\cos\phi\sin\psi & a_{13} = \sin\phi \\ a_{21} = \cos\phi\sin\psi + \sin\phi\cos\psi\cos\psi & a_{22} = \cos\phi\cos\psi - \sin\phi\sin\psi\cos\psi & a_{23} = -\sin\phi\cos\psi \\ a_{31} = \sin\phi\sin\psi - \cos\phi\cos\psi\cos\psi & a_{32} = \sin\phi\cos\psi + \cos\phi\sin\psi\cos\psi & a_{33} = \cos\phi\cos\psi \end{pmatrix} \quad \bullet \bullet \bullet \quad (4)$$

【0043】図9は平行投影の説明図である。平行投影の場合は、中心投影の投影中心 $O_c$ に相当する点がない。そこで、対象座標系54として回転を考慮した座標系 $(X_R, Y_R, Z_R)$ を用い、縮尺係数として $K_1, K_2$ を選定すると次式が成立する。

【数5】

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} K_1 00 \\ 0 K_2 0 \\ 000 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X_R \\ Y_R \\ Z_R \end{pmatrix} \quad \bullet \bullet \bullet \quad (5)$$

すると、対象座標系54で選択した原点 $(X_0, Y_0, Z_0)$ とオリエンテーション行列 $A$ を用いて、次のように表せる。

【数6】

$$\begin{pmatrix} X_R \\ Y_R \\ Z_R \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} X - X_0 \\ Y - Y_0 \\ Z - Z_0 \end{pmatrix} \quad \bullet \bullet \bullet \quad (6)$$

ここで、オリエンテーション行列 $A$ の要素 $a_{ij}$ に関しては式(4)に相当する関係が成立している。

【0044】傾位修正パラメータの算出においては、式(2)～(4)又は式(5)、(6)に含まれる6つの外部座標系要素 $\phi, \psi, \kappa, X_0, Y_0, Z_0$ を求める。即ち、S210において、これらの式を、最低3点以上の基準マークにより観測方程式を立て、逐次近似的法によってこれら6つの外部座標系要素を算出する。具体的には、未知変量の近似値を与え、近似値のまわりにテラ一展開して線形化し、最小二乗法により補正量を求めて近似値を補正し、同様の操作を繰り返して収束解を求める逐次近似的法によってこれら6つの外部座標系要素を求めることができる。また、式(2)～(4)又は式(5)、(6)に代えて、単写真座標定や相互座標定、その空中三角測量で外部座標定として用いられている各種の演算式のうちから適宜選択して演算を行うとよい。

【0045】[レンズ歪補正]電子光学系2を構成する電子レンズの歪曲収差まで求める場合には、さらに後者の基準マークを用意し、撮像方向からの画像を得ることにより式(7)、(8)によって補正することが可能となる。即ち、式(2)～(4)又は式(5)、(6)でさらにレンズ歪を補正した $x, y$ 座標を $x', y'$ とすれば、次式が成立する。

$$x' = x + \Delta x \quad \bullet \bullet \bullet \quad (7)$$

$$y' = y + \Delta y$$

ここで、 $k_1, k_2$ は放射方向レンズ歪み係数とすると、 $\Delta x, \Delta y$ は次式により表される。

【数7】

$$\begin{aligned} \Delta x &= x_0 + x(k_1 r^2 + k_2 r^4) \\ \Delta y &= y_0 + y(k_1 r^2 + k_2 r^4) \quad \bullet \bullet \bullet \quad (8) \\ r^2 &= (x^2 + y^2)/c^2 \end{aligned}$$

【0046】電子レンズの歪曲収差の計算は、画像座標と対象座標を計測することにより、上式にあてはめ逐次近似的法によって算出される。また、レンズ歪係数は、式(8)では放射方向レンズ歪みとしているが、さらにタンジェンシャルレンズ歪みやスパイラルレンズ歪み、その他電子レンズの歪曲収差の修正に必要な要素を式(8)に加えてレンズ歪係数を求めれば、それらの修正(キャリブレーション)が可能となる。

【0047】続いて、傾位修正パラメータを取得した後に、試料のステレオ画像を処理する処理手順について説明する。図10は傾位修正パラメータを用いて試料のステレオ画像を処理する手順の流れ図である。まず、画像・計測したい試料9を試料ホルダ3にセットする(S252)。続いて、ビーム傾斜制御部5aにより、電子線7の試料ホルダ3に対する傾斜角を2つ以上にして、電子線検出部4で試料9に対する第1及び第2の検出データを検出し、ステレオ撮影を行って画像を取り込む(S254)。この2つ以上の傾斜角は、S206において傾位修正パラメータを取得するのに用いた、試料ホルダ3と照射電子線7とがなす第1及び第2の相対的傾斜角度と同じ角度とする。

【0048】次に、倍率変更部6の設定倍率により、試料9の撮影は中心投影か平行投影かを判別する(S256)。中心投影の場合には、傾位修正パラメータとしての6つの外部座標系要素 $\phi, \psi, \kappa, X_0, Y_0, Z_0$ を用いて、対象座標に該当する画像座標を式(2)～(4)に代入して求め、それをステレオ表示したい立体画像座標系33の座標系に変換して、再配列を行えば、データ修正部31により検出器4で検出するステレオ画像の傾位修正画像を作成することができる(S258)。平行投影の場合には、6つの外部座標系要素 $\phi, \psi, \kappa, X_0, Y_0, Z_0$ を用いて、対象座標に該当する画像座標を式(5)、(6)に代入して求め、それをステレオ表示したい立体画像座標系33の座標系に変換

して、再配列を行えば、データ修正部31により検出器4で検出するステレオ画像の偏位修正画像を作成することができる(5260)。

【0019】そして、偏位修正パラメータによって偏位修正されたステレオ画像は一旦ステレオ画像記憶部34に記録されると共に、立体画像観察部33で立体表示する(5262)。なお、立体画像観察部33のような立体モニタがない場合は、代替手段として表示部22の1画面上に2画像表示すると、オペレータ側の対応で立体視が可能となる。

【0050】次に、形状測定部32により、データ修正部31により修正されたステレオ画像に基づき試料9の三次元計測したい箇所を計測する(5264)。三次元計測は立体表示させた左右画像を計測することにより(特視差を求める)、三角測量の原理により算出される。左右画像の計測はマニュアル、或いは画像相関処理等を用いて行うことができる。

【0051】そして、測定終了であるか判断し(5266)、測定を継続するのであれば既に求めた偏位修正パラメータが利用できるか判断する(5267)、同じ倍率で別試料を測定する場合と、違う倍率で測定を行う場合であっても電子顕微鏡の倍率再現性があるときは、既に求めてある偏位修正パラメータを利用して、5252に戻って計測を繰り返す。電子顕微鏡に倍率再現

$$g(i, j) = f(i, j) - \nabla^2 f(i, j) \quad \dots (9)$$

ここで、 $g(i, j)$  は鮮鋭化画像である。また、入力画像のラプラシアン $\nabla^2 f(i, j)$ に関しては、ラプラシアン・オペレータ、線検出オペレータ等のいろいろな形の微分オペレータがある。

【0054】図12は3×3画素用の画像鮮鋭化処理の微分オペレータである。(A)はラプラシアン・オペレータ、(B)は線検出オペレータである。中心の画素に重み付けをし、隣接する画素に軽い重み付けをすることで鮮鋭化処理を行っている。なお、画像鮮鋭化処理の微分オペレータは、図12の3×3画素用微分オペレータにガウス曲線による重み付けの修正を施したものとし

$$\nabla^2 G(x, y) = \frac{x^2 + y^2}{2\sigma^2} \exp\left\{-\frac{(x^2 + y^2)}{2\sigma^2}\right\} \dots (10)$$

式(10)は、計算処理の中にガウス曲線による減衰の微分緩和措置を内蔵させたものである。

【0057】図11に戻り、基準マークパターン発生器23では、特徴点の位置と数が十分に判別し(5310)、十分にあれば特徴点を基準マークとして扱う(5311)。不十分であれば既存の特徴点を基準マークとして扱うと共に、追加して形成すべき基準マークの位置決定をし(5312)、基準マークパターン発生器23により基準マークを作成する(5314)、特徴点の位置と数が十分か否かを判断するために、画像作成処理部21により作成された画像をブロック分けしてから判断するといふ。

性がない場合、或いは経時変化がある場合は、既に求めた偏位修正パラメータが利用できるか、図6の5202に戻り、最初から基準テンプレート40を使用して倍率に応じた偏位修正パラメータを算出する。測定終了の場合は試料9を試料ホルダ3から抜いて終了する(5268)。

【0052】図11は試料に存在する基準マークを用いてステレオ画像の観察を行う手順の流れ図である。まず、試料9を試料ホルダ3に挿入する(5302)。続いて、倍率変更部6により試料9を観察又は計測する倍率を設定する(5304)。そして、設定した倍率にて電子線7により試料9の面上をアブレーションする(5306)、アブレーションにより検出器4が二次電子を検出して、画像作成処理部21により画像が作成される。基準マークパターン発生器23では、画像作成処理部21により作成された画像から特徴点を抽出する(5308)。ここで、特徴点とは基準マークのように偏位修正パラメータの算出に適する位置に存在する明認できるマークである。

【0053】「特徴点の抽出処理」ここで、基準マークパターン発生器23で行う特徴点の抽出処理について説明する。入力画像を $f(i, j)$ 、入力画像のラプラシアンを $\nabla^2 f(i, j)$ とすると、画像の鮮鋭化処理が行われる。

$$g(i, j) = f(i, j) - \nabla^2 f(i, j) \quad \dots (9)$$

てもよい。

【0055】画像の鮮鋭化処理の次に、エッジ抽出処理が行われる。エッジ抽出処理は、鮮鋭化画像の濃度値のゼロ交差点をエッジとすることにより行うことができる。すなわち、ゼロとなった点のみを濃度値とする、或いはゼロを境にしてプラス領域を白、マイナス領域を黒とすることにより濃度化される。

【0056】また、式(9)を用いたデジタル画像処理に代えて、下式に示されるような計算処理によって求めてもよい。

【数8】

【0058】図13は特徴点の抽出処理後には、画像作成処理部21により作成された画像をブロック分けする場合の説明図である。画像作成処理部21により作成された画像は、例えば4個のブロックA、B、C、Dに区分する。若しくは、画像のブロック分けは各ブロックに1個若しくは2個の特徴点が存在するように定めると共に、各ブロックの面積と形状は均等になるようにするとよい。もし、あるブロックに特徴点が存在しない場合は、基準マークの作成位置を決める。

【0059】図14は基準マークの形成された試料面の一隅を示す平面図である。試料9は既に所定のパターン9aを有する半導体基板とす。試料9の画像の四隅に

は基準マーク9aが形成されている。このような基準マーク9aは、試料面を背景画像」とし、標準的な基準マークを有する探索画像1にてマッチングをとることで、容易に検出できる。

【0060】図11に於いて、ビーム傾斜制御部5aにて電子線7の傾斜角を制御して電子線7、7Lを切替えて、画像作成処理部21に画像を必要枚数取り込む（S316）。倍率変更部にて設定される倍率により、データ修正部31にて中心投影により傾位修正パラメータを算出するのかわ、平行投影により傾位修正パラメータを算出するのかわ選択する（S318）。続いて、両画像中の基準マークの座標を検出する（S320、S324）。図13に示すように、基準マークがどのブロックにあるかわ判明しているため、図7及び図14に示すように、画像相関処理によってその領域を探索、検出する。

【0061】データ修正部31は、検出された基準マークの画像座標の座標から、中心投影の場合は前述した式（2）～（4）を使って傾位修正パラメータを算出する。そして、傾位修正パラメータとしての6つの外部固定要素 $\omega$ 、 $\phi$ 、 $\alpha$ 、 $X_0$ 、 $Y_0$ 、 $Z_0$ を用いて、対象座標に該当する画像座標を式（2）～（4）に代入して求め、それをステレオ表示したい立体画像観測部33の座標系に変換して、再配列を行えば、データ修正部31により検出器4で検出するステレオ画像の傾位修正画像を作成することができる（S322）。

【0062】平行投影の場合は前述した式（5）、（6）を使って傾位修正パラメータを算出する。レンズ歪補正を行う場合は、式（7）を使って傾位修正パラメータを算出する。そして、6つの外部固定要素 $\omega$ 、 $\phi$ 、 $\alpha$ 、 $X_0$ 、 $Y_0$ 、 $Z_0$ を用いて、対象座標に該当する画像座標を式（5）、（6）に代入して求め、それをステレオ表示したい立体画像観測部33の座標系に変換して、再配列を行えば、データ修正部31により検出器4で検出するステレオ画像の傾位修正画像を作成することができる（S326）。

【0063】続いて、ステレオ画像の傾位修正画像を立体画像観測部33に表示して、立体画像観測可能とする（S328）。次に、形状測定部32により、データ修正部31により修正されたステレオ画像に基づき試料9の三次元計測したい箇所を計測する（S330）。そして、測定終了であるかわ判断し（S332）、さらに同じ倍率で別試料を測定する場合、或いは倍率を変更して行う場合は、S304に戻って計測を繰り返す。測定終了の場合は試料9を試料ホルダ3から抜いて終了する（S334）。ここで、倍率を変更して同じ試料9を計測する場合、基準マークを既に作成してあるため、それかわ特徴点として使用可能かは、S308の特徴検出処理にて判定して使用可能であれば使用する。使用できなければ、基準マークを新たに作成する（S312、S314）。

【0064】なお、図11に示す処理は画像作成処理部

21を介して自動で行う実施の形態を示したが、表示装置22にアスキャン画像を表示しながらオペレータがマニュアルにて実行してもよい。

【0065】「第2の実施の形態」図15は本発明の第2の実施の形態を説明する構成ブロック図で、試料ホルダの傾斜角度を変えて透過型顕微鏡のステレオ画像を得る場合を示している。第2の実施の形態では、試料ホルダ3を傾斜制御する傾斜制御部5としてホルダ傾斜制御部5bを用いており、ビーム傾斜制御部5aは作動させない。ホルダ傾斜制御部5bによる試料ホルダ3と照射電子線7の相対的傾斜角度は、ここでは右側上がりRと左側上がりLの二通りに切替えて設定する場合を図示しているが、2段に限らず多段に設定してもよいが、ステレオの検出データを得る為には最小2段必要である。試料9を所定角度（ $\alpha$ ）傾けて検出器4で撮影すること、試料9を固定して電子線7を所定角度（ $\beta$ ）傾けて照射し、検出器4で撮像することと等価となる。

【0066】このように構成された装置においても、第1の実施の形態と同様に検出した生の画像を傾位修正画像に修正して立体視できるようにする。傾位修正画像に修正する座標としては、図6、図10に示すように基準テンプレートを用いて傾位修正パラメータを取得し、その後試料のステレオ画像を処理するものと、図11に示すように試料の基準マークを用いて直接ステレオ画像を処理するものとがある。

【0067】「第3の実施の形態」図16は本発明の第3の実施の形態を説明する構成ブロック図で、試料ホルダの傾斜角度を変えて透過型顕微鏡のステレオ画像を得る場合を示している。電子線装置10が透過型顕微鏡であるため、電子線検出部4a、4bが試料ホルダ3を挟んで電子線源1の反対側にある。電子光学系2は、電子線7を試料9に照射する第1の電子光学系と、試料9を透過した電子線7をCCD（Charge-coupled devices）等の検出器4aに受く第2の電子光学系を有している。第1の電子光学系として、電子線源1から放射された電子線7の電子流密度、開き角、照射面積等を変えるコンデンサレンズ2aが設けられている。第2の電子光学系として、結核レンズ系の初段にある対物レンズ2g、対物レンズ2gの像面に作られる像、あるいは像面像面に作られる回折像を拡大・投影する中間レンズ2eと投影レンズ2fが設けられている。

【0068】検出器4aの検出信号はCCD制御部1bを介して画像作成処理部21に送られる。倍率変更部8は電子光学系2の倍率を変えるもので、ここでは対物レンズ2g、中間レンズ2e、投影レンズ2fに倍率制御信号を送っている。試料ホルダ3を傾斜制御する傾斜制御部5としてホルダ傾斜制御部5bを用いている。なお、透過型顕微鏡であっても、試料ホルダ3を傾斜制御する傾斜制御部5としてビーム傾斜制御部に相当する構成要素を用いてもよい。

【0069】このように構成された装置においても、第1の実施の形態と同様に検出した生の画像を傾位修正画像に修正して立体視できるようにする。傾位修正画像に修正する態様としては、図6、図10に示すように基準テンプレートをを用いて傾位修正パラメータを取得し、その後試料のステレオ画像を処理するものと、図11に示すように試料の基準マークを用いて直接ステレオ画像を処理するものとがある。

【0070】なお、上記実施の形態においては、電子顕微鏡としてビーム傾斜制御部により電子線を偏向させてステレオ画像を得る方式と、ホルダ傾斜制御部により試料を傾斜させてステレオ画像を得る方式との両方式が採用できる構成となっているが、本発明はこれに限定されるものではなく、ビーム傾斜制御部とホルダ傾斜制御部の何れか一方を備える電子顕微鏡としても構わない。

#### 【0071】

【発明の効果】以上説明したように、本発明の電子線装置によれば、電子線を放射する電子線源と、電子線を試料に照射する電子光学系と、試料を保持する試料ホルダと、試料ホルダと照射電子線とを相対的に傾斜させる試料傾斜部と、試料から出射される電子線を検出する電子線検出部と、試料ホルダと照射電子線とを相対的に傾斜させた際のステレオの検出データを所定の関係でデータ修正するデータ修正部とを備えている。そこで、データ修正部によって、ステレオの検出データとしての2枚の画像データを傾位修正して、画像の歪みをできる状態にでき、空中三角測量のデータ処理方法に準拠して、試料の三次元形状測定や立体的な画像を形成できる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】 3本の同じ長さの直線パターンが等間隔に存在している被写体に対して所定の傾斜角度で撮影した画像の説明図である。

【図2】 図1(A)、(B)の傾斜画像を傾位修正画像に修正したステレオ画像の説明図である。

【図3】 本発明の第1の実施の形態を説明する構成ブロック図で、走査型顕微鏡の電子線を偏向させてステレオ画像を得る場合を示している。

【図4】 試料若しくは基準テンプレート基板に形成する基準マークの説明図である。

【図5】 試料若しくは基準テンプレート基板に基準マークを作成する手順を示す流れ図である。

【図6】 基準テンプレートを用いて傾位修正パラメータを取得する処理の流れ図である。

【図7】 画像相関処理の説明図である。

【図8】 中心投影の説明図である。

【図9】 平行投影の説明図である。

【図10】 傾位修正パラメータを用いて試料のステレオ画像を処理する手順の流れ図である。

【図11】 試料に存在する基準マークを用いてステレオ画像の観察を行う手順の流れ図である。

【図12】 3×3画素用の画像鮮鋭化処理の微分オペレータである。

【図13】 特徴点の抽出処理後、画像作成処理部により作成された画像をブロック分けする場合の説明図である。

【図14】 基準マークの形成された試料面の一例を示す平面図である。

【図15】 本発明の第2の実施の形態を説明する構成ブロック図で、試料ホルダの傾斜角度を変えて走査型顕微鏡のステレオ画像を得る場合を示している。

【図16】 本発明の第3の実施の形態を説明する構成ブロック図で、試料ホルダの傾斜角度を変えて透過型顕微鏡のステレオ画像を得る場合を示している。

#### 【符号の説明】

- 1 電子線源
- 2 電子光学系
- 3 試料ホルダ
- 4 電子線検出部
- 5 データ修正部
- 5a ビーム傾斜制御部
- 5b ホルダ傾斜制御部
- 6 信号変換部
- 7 電子線
- 9 試料
- 10 電子線装置
- 20 データ処理装置
- 21 画像作成処理部
- 22 表示装置
- 23 基準マークパターン発生器
- 25 測定条件判別部
- 31 データ修正部
- 31a 傾位修正パラメータ取得手段
- 31b 画像データ傾位修正手段
- 32 形状測定部
- 33 立体画像観察部
- 34 ステレオ画像記憶部

【図12】

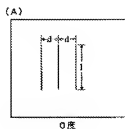
(A) グラフオペレータ

0	-1	0
-1	5	-1
0	-1	0

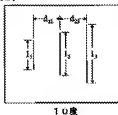
(B) 転換オペレータ

-1/2	1	-1/2
-1/2	1	-1/2
-1/2	1	-1/2

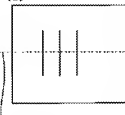
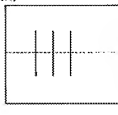
【附1】



(B)

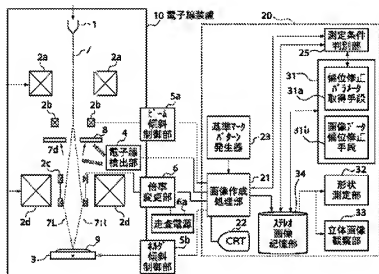


{A}

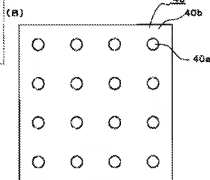
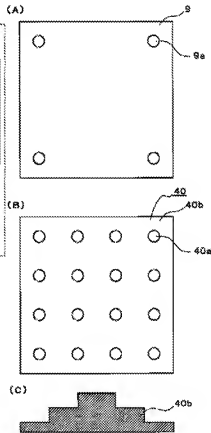


エビボ-ラライン

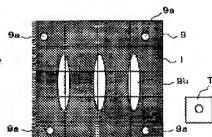
431



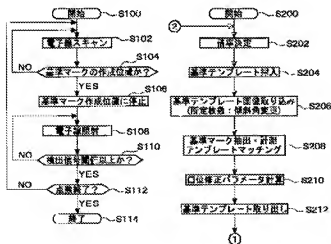
【图4】



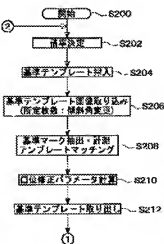
【圖14】



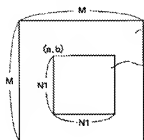
【附註】



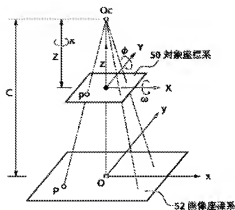
【26】



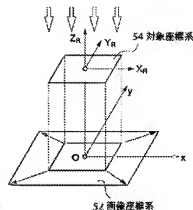
【図7】



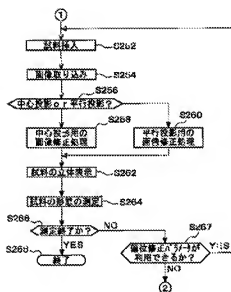
【図8】



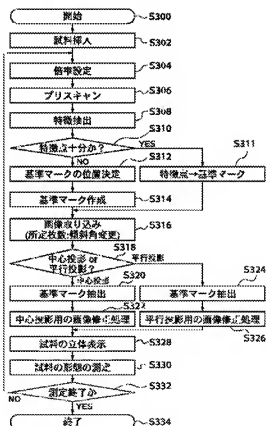
【図9】



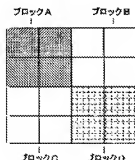
【図10】



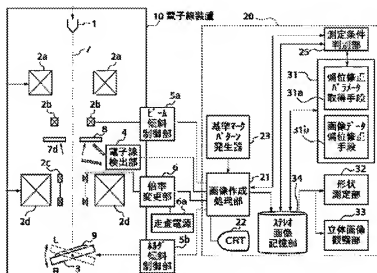
【図11】



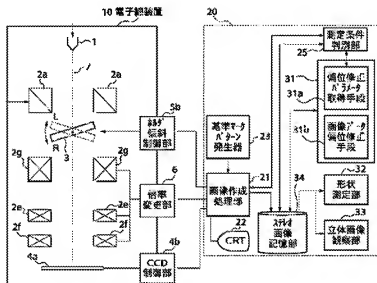
【図13】



【15】



【例 16】



フロントページの続き

(5) InL, Cl. <sup>17</sup>	識別記号	F I	(参考)
G 2 1 K	5/00	G 2 1 K	5/00 A
	5/04		M
H O 1 J	37/22	H O 1 J	37/22 5 O 1 A
	5 O 1		5 O 2 H
	5 O 2		
	37/26		37/26
H O 1 L	21/66	H O 1 L	21/66 J

フレーム(参考) 2F067 AA53 HH06 HH13 JJ05 KK04

LL16

2J001 AA03 BA07 BA11 CA03 DA01

DA09 FA06 FA08 GA06 GA09

GA13 HA13 JA07 LA11 PA15

4M106 AA02 RA02 CA38 DB04 DB05

DB12 DB18 DB30 DJ02 DJ15

DJ19 DJ20 DJ21 DJ24

5C033 SS02 SS04 SS10 UU01 UU03

UU05 UU06